Электрические и оптические свойства нерелаксированных гетероэпитаксиальных структур InAs_{1-x}Sb_x

© Р.Р. Гусейнов¹, В.А. Танрывердиев¹, G.L. Belenky², G. Kipshidze², Е.Н. Алиева¹, X.В. Алигулиева¹, Э.Г. Ализаде¹, X.Н. Ахмедова¹, Н.А. Абдуллаев¹, ¶, H.Т. Мамедов¹, В.Н. Зверев³

 ¹ Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Az-1143 Баку, Азербайджан
 ² Stony Brook University, Stony Brook, 11794 N. Y., USA
 ³ Институт физики твердого тела Российской академии наук, 142432 Черноголовка, Московская обл., Россия

[¶] E-mail: abnadir@mail.ru

Поступила в Редакцию 10 декабря 2018 г. В окончательной редакции 18 декабря 2018 г. Принята к публикации 18 декабря 2018 г.

Исследованы электрические и гальваномагнитные свойства нерелаксированных гетероэпитаксиальных структур $InAs_{1-x}Sb_x$ (x = 0.43 и 0.38) в широком интервале температур 5–300 К и магнитных полей до 8 Тл. Из термоактивационной зависимости электропроводности оценена ширина запрещенной зоны состава $InAs_{0.57}Sb_{0.43}$, она равна 120 мэВ. Определенные из эффекта Холла концентрации электронов в $InAs_{1-x}Sb_x$ ($6 \cdot 10^{16}$ см⁻³ для $InAs_{0.62}Sb_{0.38}$ и $5 \cdot 10^{16}$ см⁻³ для $InAs_{0.57}Sb_{0.43}$) хорошо согласуются с концентрацией электронов, вычисленной из осцилляций Шубникова–де Гааза. Также проведены спектральные эллипсометрические исследования нерелаксированных гетероэпитаксиальных структур $InAs_{1-x}Sb_x$ (x = 0.43 и 0.38) в области энергий фотонов 1–6 эВ. Определены спектральные зависимости мнимой и действительной частей диэлектрической проницаемости. Вычислены и приведены дисперсионные зависимости коэффициентов преломления и экстинкции.

Ключевые слова: гетероэпитаксиальные структуры, удельное сопротивление, эффект Холла, осцилляции Шубникова-де Гааза, спектральная эллипсометрия, диэлектрическая функция.

DOI: 10.21883/FTP.2019.07.47868.9044

1. Введение

Материалы на основе твердых растворов группы III–V, способные поглощать и излучать свет в технологически важной области спектра от 3 до 12 мкм, в которую попадают окна прозрачности атмосферы, являются перспективными материалами для инфракрасной технологии. Наиболее подходящими для практического применения являются твердые растворы $InAs_{1-x}Sb_x$, обладающие уникальным свойством широкого диапазона варьирования ширины запрещенной зоны от состава (от величины x), попадающие в указанную область спектра.

В предыдущей статье [1] нами была подробно изложена методика получения гетероэпитаксиальных структур и их характеризация методами высокоразрешающей рентгеновской дифракции, сканирующей атомносиловой микроскопии и микро-рамановского рассеяния. Показано, что получены нерелаксированные слои твердого раствора $InAs_{1-x}Sb_x$ методом молекулярнолучевой эпитаксии с использованием градиентных буферных слоев GaInSb и AlGaInSb. Целью настоящей работы являлось исследование электрических и оптических свойств гетероэпитаксиальных $InAs_{1-x}Sb_x$ -структур (x = 0.43 и 0.38).

2. Электрические и гальваномагнитные исследования

Исследования электропроводности проводились в широкой области температур 5–300 К стандартным четырехзондовым методом по селективной методике на частоте 20.5 Гц с использованием Lock in Amplifier SR 905. Точечные контакты наносились с помощью серебряной пасты. Магнитное поле создавалось сверхпроводящим соленоидом, образцы помещались в центр соленоида, максимальное магнитное поле достигало 8 Тл. Величина тока не превышала 1 мА для исключения перегрева образцов.

На рис. 1 приведена температурная зависимость удельного сопротивления ρ образца InAs_{0.57}Sb_{0.43} в области температур T = 5-300 К в координатах Аррениуса. Хорошо заметен термоактивационный характер температурной зависимости сопротивления в области 300–100 К, характерный для собственной проводимости,

$$\rho = \rho_0 e^{\Delta E/2kT},\tag{1}$$

с уменьшением температуры удельное сопротивление пленки экспоненциально возрастает. Здесь ΔE — ширина запрещенной зоны. Оценки ширины запрещенной зоны из (1) дают величину $\Delta E \approx 120 \text{ мэB}$, что



Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления образца InAs_{0.57}Sb_{0.43} в области 5–300 К.



Рис. 2. Магнитополевая зависимость сопротивления в образцах $InAs_{0.57}Sb_{0.43}$ при температуре T = 5 K.

удовлетворительно согласуется с данными измерений фотолюминесценции твердых растворов $InAs_{1-x}Sb_x$ [2]. Наблюдаемое плато в области температур T < 100 К на рис. 1 обусловлено тем, что повышение сопротивления шунтируется более низкоомными нижележащими слоями гетероэпитаксиальной структуры.

Исследования эффекта Холла показали, что все образцы были *n*-типа проводимости. Оцененная из полевой зависимости холловского напряжения для $InAs_{0.62}Sb_{0.38}$ величина концентрации электронов оказалась равной $n = 6 \cdot 10^{16}$ см⁻³. Для состава $InAs_{0.57}Sb_{0.43}$ концентрация электронов равна $n = 5 \cdot 10^{16}$ см⁻³. Как видно, с увеличением содержания атомов Sb концентрация электронов в твердом растворе $InAs_{1-x}Sb_x$ уменьшается.

На рис. 2 приведена магнитополевая зависимость сопротивления в образцах InAs_{0.57}Sb_{0.43}. Как видно, наблюдается наличие значительного магнитосопротивления:

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 7

при величине магнитного поля B = 7 Тл сопротивление возрастает почти в 13 раз, т. е. относительное изменение $\Delta \rho / \rho \approx 12$. Это свидетельствует о высокой подвижности носителей заряда — электронов. Кроме того, на полевой зависимости магнитосопротивления наблюдаются биения, характерные для осцилляций Шубникова-де Газа.

Период выделенных фурье-анализом осцилляций на полевой зависимости магнитосопротивления в обратном магнитном поле напряженности H оказался примерно равен $P(1/H) = 2.25 \cdot 10^{-5} \, \Im^{-1}$.

Как известно, из периода *P* осцилляций магнитосопротивления можно оценить концентрацию *n* носителей заряда. В общем случае для замкнутой поверхности Ферми произвольной формы период осцилляций определяется выражением [3]

$$P\left(\frac{1}{H}\right) = \frac{2\pi e}{\hbar c S_{\rm F}}.$$
(2)

Здесь $S_{\rm F}$ — экстремальная площадь сечения поверхности Ферми $E(\mathbf{k}) = \mu_{\rm F}$ плоскостью, перпендикулярной направлению магнитного поля. Для соединений типа InSb концентрация носителей заряда определяется из соотношения

$$n = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2e}{c\,\hbar P(1/H)} \right)^{3/2}.$$
 (3)

Вычисления согласно (3) дают величину $n \approx 5.7 \cdot 10^{16} \, {\rm сm}^{-3}$.

Таким образом, концентрация носителей заряда, определенная из осцилляций Шубникова-де Гааза, хорошо согласуется с концентрацией, вычисленной из данных измерений эффекта Холла.

3. Оптические исследования

Для определения оптических параметров гетероэпитаксиальных $InAs_{1-x}Sb_x$ -структур нами были проведены спектральные исследования методом эллипсометрии, являющимся высокочувствительным и точным оптическим методом исследования поверхностей и границ раздела различных сред. Этот метод основан на изучении изменения состояния поляризации отраженного света после взаимодействия его с поверхностью границ раздела этих сред. Измерения проводились на эллипсометре оптического диапазона M-2000 DI (J.A. Woollam Co, Inc.). Спектральная зависимость эллипсометрических параметров Δ и Ψ снималась в диапазоне энергий фотонов 1-6 эВ с шагом 50 мэВ при углах падения 50, 55 и 60°.

Основное уравнение эллипсометрии, связывающее между собой эллипсометрические параметры Δ , Ψ и комплексные значения коэффициентов отражения Френеля r_p и r_s для p- и s-компонент эллиптически поляризованного света, записывается в виде [4]

$$tg(\Psi)\exp(i\Delta) = \frac{r_p}{r_s}.$$
 (4)



Рис. 3. Спектральные зависимости действительной ε_r (*a*), и мнимой, ε_i (*b*) частей диэлектрической функции гетероэпитаксиальных структур InAs_{0.57}Sb_{0.43} (*1*) и InAs_{0.62}Sb_{0.38} (*2*).



Рис. 4. Спектральные зависимости действительной (*a*) и мнимой (*b*) частей дилектрической функции InAs_{0.57}Sb_{0.43} (x = 0.43), InAs (x = 0), InSb (x = 1).

Выбор адекватной оптической модели, правильно описывающей отражательные свойства исследуемого образца, является одним из важных этапов при эллипсометрических исследованиях. Глубина проникновения оптического излучения может быть оценена из соотношения $\lambda/2\pi k$, где k — коэффициент экстинкции. Для оптического излучения видимого диапазона при анализе системы InAsSb такая глубина составляет с учетом данных по коэффициенту экстинкции для InAs и InSb [5] до ~ 100 нм. В нашем случае толщина верхнего рабочего эпитаксиального слоя в исследуемых структурах составляет ~ 400 нм [1]. Это позволяет утверждать, что при эллипсометрических исследованиях мы получаем информацию лишь от верхнего слоя исследуемого многослойного покрытия.

На рис. З приведены действительная, ε_r , и мнимая, ε_i , части диэлектрической функции InAs_{0.57}Sb_{0.43} (кривые 1), InAs_{0.62}Sb_{0.38} (кривые 2). Надо отметить схожий характер зависимостей, что неудивительно для соединений со столь схожей структурой и близкими составами.

Для сравнения на рис. 4 показаны действительная, ε_r , и мнимая, ε_i , части диэлектрической функции исследованной нами гетероэпитаксиальной структуры



Рис. 5. Спектральные зависимости показателей преломления, n(E), и экстинкции, k(E), для гетероэпитаксиальной структуры InAs_{0.57}Sb_{0.43} и монокристаллов InAs, InSb [5].

InAs_{1-x}Sb_x (x = 0.43) и материнских составов InAs (x = 0) и InSb (x = 1) для различных энергий фотонов [5]. Наблюдается хорошая корреляция особенностей на зависимостях $\varepsilon_r(E)$ и $\varepsilon_i(E)$.

Для расчета показателя преломления *n* и коэффициента экстинкции *k* нами применялись формулы

$$n = \sqrt{\frac{\varepsilon_r + \sqrt{\varepsilon_r^2 + \varepsilon_i^2}}{2}},\tag{5}$$

$$k = \frac{\varepsilon_i}{\sqrt{2\left(\varepsilon_r + \sqrt{\varepsilon_r^2 + \varepsilon_i^2}\right)}}.$$
 (6)

Вычисленные зависимости n(E) и k(E) для гетероэпитаксиальной структуры InAs_{0.57}Sb_{0.43} приведены на рис. 5. На этом же рисунке приведены зависимости n(E)и k(E) для монокристаллов InAs и InSb [5].

4. Заключение

Вычисленная из активационной зависимости сопротивления от температуры для гетероэпитаксиальной структуры InAs_{0.57}Sb_{0.43} энергия активации оказалась

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 7

равной 120 мэВ, что согласуется с данными о ширине запрещенной зоны из исследований фотолюминесценции этих соединений.

Из данных измерений эффекта Холла выявлен электронный характер проводимости с концентрацией электронов $n = 6 \cdot 10^{16}$ см⁻³ (для InAs_{0.62}Sb_{0.38}) и $n = 5 \cdot 10^{16}$ см⁻³ (для InAs_{0.57}Sb_{0.43}). Как видно, с увеличением содержания атомов Sb концентрация электронов в твердом растворе InAs_{1-x}Sb_x уменьшается.

Исследования магнитосопротивления выявили большое положительное магнитосопротивление в гетероэпитаксиальных структурах $InAs_{1-x}Sb_x$ (x = 0.43 и 0.38): при величине магнитного поля B = 7 Тл сопротивление возрастает почти в 13 раз, т.е. $\Delta \rho / \rho = 12$. Это свидетельствует о высокой подвижности носителей заряда — электронов. Кроме того, на полевой зависимости магнитосопротивления наблюдаются биения, характерные для осцилляций Шубникова-де Гааза.

Проведен фурье-анализ осцилляций магнитосопротивления. Оцененная из периода осцилляций магнитосопротивления величина концентрации носителей заряда оказалась равной $n \approx 5.7 \cdot 10^{16} \, \mathrm{сm}^{-3}$, что удовлетворительно согласуется с данными по измерению эффекта Холла.

Из спектральных эллипсометрических измерений получены значения действительной, ε_r , и мнимой, ε_i частей диэлектрической функции InAs_{0.57}Sb_{0.43} и InAs_{0.62}Sb_{0.38} в диапазоне энергий фотонов 1–6 эВ. Вычислены и приведены дисперсионные зависимости показателей преломления n(E) и экстинкции k(E).

Благодарности

Часть работы выполнена В.Н.З. в рамках госзадания ИФТТ РАН.

Финансирование работы

Работа выполнена благодаря финансовой поддержке US National Science Foundation (Grant No. DMR1160843) и Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской республики (гранты EIF-2013-9(15)-46/06/1 и EİF/MQM/Elm-Tehsil-1-2016-1(26)-71/16/1).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- P.P. Гусейнов, В.А. Танрывердиев, G. Kipshidze, Е.Н. Алиева, Х.В. Алигулиева, Н.А. Абдуллаев, Н.Т. Мамедов. ФТП, 51, 551 (2017).
- [2] Z.M. Fang, K.Y. Ma, D.H. Jaw, R.M. Cohen, G.B. Stringfellow. J. Appl. Phys., 67, 7034 (1990).
- [3] И.М. Лифшиц, А.М. Косевич. ЖЭТФ, 29, 730 (1955).
- [4] H. Fujiwara. Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications (West Sussex, John Wiley & Sons Ltd, 2007).
- [5] D.E. Aspnes, A.A. Studna. Phys. Rev. B, 27, 985 (1983).

Редактор Л.В. Шаронова

Electrical and optical properties of unrelaxed $InAs_{1-x}Sb_x$ heteroepitaxial structures

R.R. Guseynov¹, V.A. Tanriverdiyev¹, G.L. Belenky², G. Kipshidze², Y.N. Aliyeva¹, Kh.V. Aliguliyeva¹, E.G. Alizade¹, Kh.N. Akhmedova¹, N.A. Abdullayev¹, N.T. Mamedov¹, V.N. Zverev³

 ¹ Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Az-1143 Baku, Azerbaijan
 ² Stony Brook University, Stony Brook, N. Y. 11794, USA
 ³ Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, 142432 Chernogolovka, Russia

Abstract The electrical and galvanomagnetic properties of unrelaxed heteroepitaxial structures of $InAs_{1-x}Sb_x$ (x = 0.43 and 0.38) were studied in the wide temperature range of $5{-}300\,\mathrm{K}$ and magnetic fields up to 8T. The band gap of the composition InAs_{0.57}Sb_{0.43} was estimated from the thermo-activation dependence of the electrical conductivity, and is equal to 120 meV. The electron concentration in $InAs_{1-x}Sb_x$ ($n = 6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ for $InAs_{0.62}Sb_{0.38}$ and $5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ for $InAs_{0.57}Sb_{0.43}$) was determined from the Hall effect and consistent with the electron concentration calculated from Shubnikov-de Haas oscillations. Also, spectral ellipsometric studies of unrelaxed heteroepitaxial structures of InAs_{1-x}Sb_x (x = 0.43 and 0.38) were implemented in the photon energy range of $1-6 \,\text{eV}$. The spectral dependences of the imaginary and real parts of the dielectric constant are determined. The dispersion dependences of the refractive indices and extinction are calculated and given.